PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

08-296557

(43)Date of publication of application: 12.11.1996

(51)Int.CI.

F04B 37/18

(21)Application number: 07-120927

(71)Applicant : ULVAC JAPAN LTD

(22)Date of filing:

21.04.1995

(72)Inventor: MIURA TATSUYA

YAHAGI MITSURU SHIBAYAMA KOJI

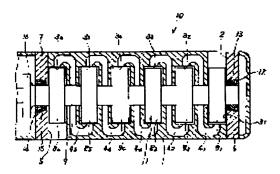
SHIMOZAKA KENTARO

(54) VACUUM PUMP

(57) Abstract:

PURPOSE: To exhaust gas, liquefied or solidified under normal temperature and normal pressure or in the close state, without liquefaction or solidification.

CONSTITUTION: The main parts of a vacuum pump 10 such as a casing 1 with cylinders 31, 32, 33, 34, 35, 36 formed, and a rotor 11 with impellers 81, 82, 83, 84, 85, 86 are formed of aluminium or an aluminium alloy.



LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

25.06.2001

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

(19)日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報 (A) (11) 特許出願公開番号

特開平8-296557

(43)公開日 平成8年(1996)11月12日

(51) Int. Cl.6

識別記号 庁内整理番号

FΙ

技術表示箇所

F 0 4 B 37/18

F 0 4 B 37/18

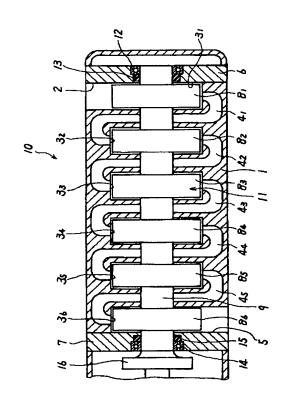
	審査請求 未請求 請求項の数4	F D	(全6頁)
(21)出願番号	特願平7-120927		(71)出願人 000231464
			日本真空技術株式会社
(22)出願日	平成7年(1995)4月21日		神奈川県茅ヶ崎市萩園2500番地
		ļ	(72)発明者 三浦 辰也
		į	神奈川県茅ケ崎市萩園2500番地 日本真空
			技術株式会社内
			(72)発明者 矢作 充
			神奈川県茅ケ崎市萩園2500番地 日本真空
			技術株式会社内
			(72)発明者 柴山 浩司
			神奈川県茅ケ崎市萩園2500番地 日本真空
			技術株式会社内
		!	(74)代理人 弁理士 飯阪 泰雄
		;	最終頁に続く

(54) 【発明の名称】真空ポンプ

(57) 【要約】

[目的] 常温、常圧或いはそれに近い状態で液化又は 固化する気体を液化又は固化させることなく排気し得る 真空ポンプを提供すること。

[構成] 真空ポンプ10のシリンダ31、32、3 3、34、35、36が形成されているケーシング1及 び羽根車81、82、83、84、85、86を持つ口 ータ11等の主要部品をアルミニウム、又はアルミニウ ム合金で作成する。



【特許請求の範囲】

【請求項1】 常温、常圧或いはそれに近い状態で液化 又は固化する気体を排気する真空ポンプにおいて、前記 気体の流路を構成するケーシング及びシリンダ、ロータ 等の主要部品がアルミニウム又はアルミニウム合金で製 作されていることを特徴とする真空ポンプ。

1

【請求項2】 前記流路に前記気体の圧縮熱を除去する ための冷却器を具備していない請求項1に記載の真空ポ ンプ。

【請求項3】 前記気体の排気を多段で行なう請求項1 10 又は2に記載の真空ポンプ。

【請求項4】 前記気体の排気がシール及び潤滑のための油類を使用することなく行われる請求項1、2又は3に記載の真空ポンプ。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明は真空ポンプに関するものであり、特に減圧CVDやドライエッチング等の半導体製造プロセスにおいて生成される常温、常圧或いはそれに近い状態で液化又は固化する気体を排気するためのド 20ライ真空ポンプに関する。

[0002]

【従来の技術】近年、半導体製造装置等において、清浄な真空を作り出すためにシールや潤滑のための油類を使用しないドライ真空ポンプが用いられるようになり、特に、鋳鉄製やステンレス製の多段真空ポンプ100のプロック図であり、6段の真空ポンプユニット110、112、114、116、118、120が流路し、によって直列に接続されている。流路し、の真空ポンプユニット16と118の間の部分、118と120の間の部分には気体を冷却するための冷却器134、136がが介装されており、流路し、を通過する気体が圧縮熱によって極めて高い温度になるのを防ぐため、流路し、を流過する冷却水によって冷却するようになっている。

【0003】ところで、半導体製造プロセスのうち、塩素系ガスを用いるアルミニウムのドライエッチングやジクロルシラン(SiH2Cl2)とアンモニア(NH3)を原料ガスとして窒化珪素(Si3N4)の成膜を40行なう減圧CVD等では、反応によって生成される塩化アルミニウム(AlCl3)ガスや塩化アンモニウム(NH4Cl)ガスが常温、常圧或はそれに近い状態で固化(昇華)するため、このガスが常温近傍の真空ポンプ内に取り込まれることによって固化温度以下に冷却され、固体状の反応生成物となって流路の各部位に付着、堆積する不都合のあることが知られている。

【0004】一般に物質はその温度と圧力によって、気相、液相、固相の何れかの状態を取る。図2は前記A1 Cl3やNH4C1と同様、常温、常圧、或はそれに近 50

い状態で固化するある物質の飽和蒸気圧曲線Sを示す図 で、飽和蒸気圧曲線Sより下側(右側)でその物質は気 相状態にあり、飽和蒸気圧曲線Sより上側(左側)にお いて液相状態又は固相状態を呈する。この図からも、こ の飽和蒸気圧曲線Sで示される物質はA点、すなわち常 温 (例えば25°C)、常圧 (例えば1×10⁵ Pa) においては液相状態又は固相状態であることが分かる。 【0005】ここで、X点の状態にあるこの物質を前記 真空ポンプ100で排気することを考える。図3の1段 目の真空ポンプユニット110の吸気口近傍の温度は室 温にあり、図2のX点の状態にある気体は吸気口の壁に 接し冷却されてB点の状態になり液化又は固化し始め る。流路し、を進み真空ポンプユニット112、11 4、116を通過して圧縮されるに伴い気体の温度は上 昇するが、流路し、を含む真空ポンプユニット112、 114、116は鋳鉄製であり熱が放散されにくいので それらの温度も上昇する。そして、高温になった気体は 4段目の真空ポンプユニット116の下流側で冷却器1 34によって冷却される。冷却器134は室温の冷却水 が流過しているので、その冷却面に接する気体は図2の E点の状態となり、冷化又は固化して冷却器134の冷 却面に付着する。

【0006】液化又は固化しなかった気体は更に真空ポ ンプユニット118で圧縮され高温になって冷却器13 6 で冷却される。冷却器136にも室温の冷却水が流過 しているので、その冷却面に接する気体は図2のF点の 状態となり、液化又は固化して冷却器136の冷却面に 付着する。そして、真空ポンプユニット120から排気 される気体は図2のD点の状態(温度100°C、圧力 1×10⁵ Pa)となって常圧雰囲気中へ排出される。 【0007】このようにして、気体は真空ポンプユニッ ト110の吸気口の近傍でB点の温度(常温)、真空ポ ンプユニット120の排出口近傍ではD点の温度(10 0°C)以上になるが、冷却器134、136で冷却さ れるので、真空ポンプ100は図2における線分BDで 示されるような温度勾配を形成していると見做し得る。 そして、1段目の真空ポンプユニット110の吸気口の 壁面や冷却器134、136の冷却面での液化又は固化 によって真空ポンプ100の性能は低下し、極端な場合 には閉塞されて運転不能に至ることが予測される。

【0008】そこで、このような不都合を解消するため特開平1-182582号公報のような真空ポンプも提案されている。図4はその真空ポンプ200のブロック図であり、6段の真空ポンプユニット210、212、214、216、218、220が直列に流路 L_2 によって接続されており、かつそれぞれには不活性ガス、例えば窒素ガスを吹き込んで気体の分圧を図2の飽和蒸気圧曲線Sよりも下げるための分圧調節機構222、224、226、228、230、232が設けられている。又、流路 L_2 の真空ポンプユニット216と218

30

の間の部分、218と220の間の部分、220の下流 側の部分に設けた冷却器234、236、238の冷却 水の流路1。に対し、冷却水の温度を調節するための冷 却水温度調節機構240が設けられており、冷却水の温 度を冷却器234、236、238の冷却面において気 体が液化又は固化しない温度、すなわち、図2において 飽和蒸気圧曲線Sの下側(右側)の気相状態を保持する 温度となるように加温調節している。

[0009]

【発明が解決しようとする課題】このような分圧調節機 10 構222、224、226、228、230、232や 冷却水温度調節機構240の付加は、真空ポンプ200 の製造コストを高め、設置スペースを増大させるばかり でなく、不活性ガスの吹き込みはランニングコストを高 くするし、冷却水温度調節機構240が調節トラブルを 発生した場合には冷却水が沸騰して機器を破壊させる恐 れもある。

【0010】本発明は上述の問題に鑑みてなされ、減圧 CVDやドライエッチング等の半導体製造プロセスにお いて生成される常温、常圧或いはそれに近い状態で液化 20 又は固化する気体を液化又は固化させることなく排気す ることのできる真空ポンプを提供することを目的とす る。

[0011]

【問題点を解決するための手段】以上の目的は、常温、 常圧或いはそれに近い状態で液化又は固化する気体を排 気する真空ポンプにおいて、前記気体の流路を構成する ケーシング及びシリンダ、ロータ等の主要部品がアルミ ニウム又はアルミニウム合金で製作されていることを特 徴とする真空ポンプ、によって達成される。

[0012]

【作用】真空ポンプにおいて気体の流路を構成する主要 部品が熱伝導率の大きいアルミニウム又はアルミニウム 合金で製作されているので、気体の圧縮熱は直ちに真空 ポンプの主要部品の全体に伝達され、かつ主要部品から 外部へ放散される。そのため、気体が最も圧縮され、最 も温度が高くなる真空ポンプの排気口近傍においても気 体の温度は上昇せず、真空ポンプの吸気口近傍は伝達、 伝導される圧縮熱によって昇温されるので、気体は液化 又は固化されない。従って気体は液化又は固化すること 40 なく排気される。

[0013]

【実施例】以下、本発明の実施例による真空ポンプにつ いて、図面を参照して説明する。図1は実施例の真空ポ ンプ10の主要部の断面図である。すなわち、真空ポン プ10は円筒状のケーシング1内おいて吸気口2から排 気口 5 に至る間に、シリンダ 3₁、 3₂、 3₃、 3₄、 35、36と、これらを結ぶ連絡流路41、42、4 з 、 4 4 、 4 5 が設けられている。ケーシング 1 の吸気 側の端面には吸気側カバー 6 が取り付けられ、排気側の 50 ケーシング 1 ないしはシリンダ 3 1 、 3 2 、 ・・・、 3

端面には排気側カバー7が取り付けられている。

【0014】各シリンダ31、32、33、34、3 s 、 3 6 には、ケーシング1の軸心部を貫通する回転軸 9に固定した羽根車81、82、83、84、85、8 6 がそれぞれ組み合わされ、6段に圧縮して排気するよ うになっている。回転軸9の一方の端部は吸気側カバー 6に固定したベアリング12に軸支され、その内側にお いてリップシール13によって気体の流路と大気とシー ルしている。回転軸9の他方の端部は同じく排気側カバ - 7に固定したベアリング14に軸支され、その内側に おいてリップシール15によって気体の流路と大気とを シールしている。各羽根車81、82、・・・、86は 回転軸9と共にロータ11を構成し、回転軸9は排気側 カバー7の外側において、回転軸9に取り付けたギヤ1 6を介し、図示しないモータによって駆動される。そし て、吸気側カバー6、排気側カバー7、シリンダ3。、 32、・・・、36と一体的なケーシング1、及びロー タ11など気体と接する主要部品は鋳鉄に比して約4倍 以上の熱伝導率を有するアルミニウム合金で製作されて いる。

【0015】本発明の実施例による真空ポンプ10は以 上のように構成されるが、次にその作用について説明す る。図2においてX点の状態にある気体は真空ポンプ1 0の常温にある吸気口2から矢印のように吸気され、そ の一部は吸気口2の壁に接し冷却されてB点の状態にな り液化又は固化するが、大部は各シリンダ31、32、 33、34、35、36を通過するに従って圧縮が強め られ発熱して、排気口5の近傍においては最も昇温す

【0016】この時、アルミニウム合金は熱伝導率が大 きいので、圧縮熱は直ちにケーシング1、ロータ11に 伝達され、ケーシング1及び排気側カバー7から外部へ 放散されると共に、ケーシング1、ロータ11において 温度の高い排気口側から温度の低い吸気口側へ伝達され て、吸気口2の近傍のケーシング1の温度、吸気側カバ 一6の温度及び羽根車8、の温度を上昇させる。従って 排気口5において気体は図2のD点の状態(温度100 °C、圧力1×10°Pa)となって矢印のように排出 される。又、吸気口2において気体は図2のC点の状態 を取るようになり、当初に吸気口2の壁に接して液化又 は固化し付着したものも再度気化されるようになる。

【0017】このようにして、気体は吸気口2の近傍で C点の温度、排気口5の近傍ではD点の温度(100° C) となるので実施例の真空ポンプ10は図2における 線分CDで示されるようなゆるい温度勾配を形成してい ると見做し得る。C点、D点は共に飽和蒸気圧曲線Sか ら下側(右側)へ充分に離れた状態であり、気体は真空 ポンプ10によって液化又は固化されることなく排気さ れる。又、この間において気体は充分に冷却されるので 5

6 等を冷却する必要がない。

【0018】以上、本発明の実施例について説明したが、勿論、本発明はこれに限定されることなく、本発明の技術的思想に基いて種々の変形が可能である。

【0019】例えば本実施例においては、6段に圧縮して排気を行なう真空ポンプ10について述べたが、本発明は1段の真空ポンプにも適用されるし、6段以下又は7段以上の真空ポンプにも適用され得る。

【0020】又、本実施例においては、円筒状のケーシング1を有する真空ポンプとしたが、円筒の外側面に放 10 熱用のフィンを設けてもよい。

【0021】又、本実施例においては、真空ポンプの気体の流路を構成する主要部品はアルミニウム合金で製作したものを採用したが、同等の熱伝導率を有するアルミニウムで製作したものを使用してもよい。

【0022】又、本実施例においては設けていないが、各シリンダ 3_1 、 3_2 、・・・、 3_6 内へ気体の分圧を下げるための不活性ガスを吹き込む機構を設けることは何等差し支えない。

[0023]

【発明の効果】以上述べたように、本発明の真空ポンプは気体の流路を構成する主要部品を熱伝導率の大きいアルミニウム又はアルミニウム合金で製作しているので、塩化アルミニウム、塩化アンモニウムや、過熱されておらず飽和蒸気圧曲線に近い状態にある水蒸気のように、常温、常圧或いはそれに近い状態で液化又は固化するような性質を有する気体を排気する場合に、吸気口から排気口に至る間において気相状態が維持されるので、気体の液化又は固化による真空ポンプの性能低下ないしは閉塞は生じない。又、運転開始当初、吸気口において一旦 30 は液化又は固化する気体があったとしても、時間の経過と共にこれらは気化される。

【0024】更には、気体の圧縮熱は直ちに真空ポンプ の流路を構成する主要部品に伝達され外部に放散される と共に、高温となる排気側から低温の吸気側へ伝導され て気体は充分に冷却されるので、圧縮熱を除去するため の冷却器を必要とせず、その点において真空ポンプの製造コストを低下させ、設置スペース的にも余裕を与える。

【図面の簡単な説明】

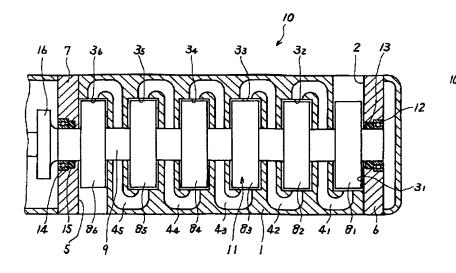
【図1】実施例の真空ポンプの主要部の断面図である。 【図2】排気される物質の飽和蒸気圧曲線を示す図であ

る。 【図3】第1従来例の真空ポンプのブロック図である。

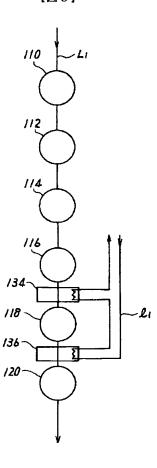
【図4】第2従来例の真空ポンプのブロック図である。

- 【符号の説明】 1 ケーシング
- 2 吸気口
- 31 シリンダ
- 32 シリンダ
- 33 シリンダ
- 34 シリンダ
- 35 シリンダ
- 36 シリンダ
- 41 連絡流路
- 20 42 連絡流路
 - 43 連絡流路
 - 44 連絡流路
 - 45 連絡流路
 - 5 排気口
 - 6 吸気側カバー
 - 7 排気側カバー
 - 8. 羽根車
 - 82 羽根車
 - 83 羽根車
 - 84 羽根車
 - 85 羽根車
 - 86 羽根車
 - 9 回転軸
 - 10 実施例の真空ポンプ
 - 11 ロータ

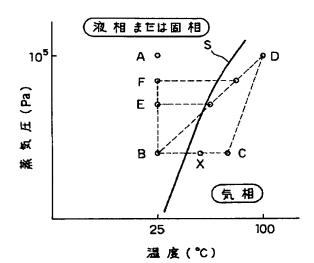
【図1】



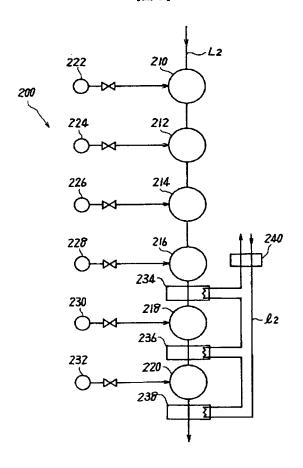
【図3】



【図2】



【図4】



フロントページの続き

(72)発明者 下坂 健太郎 神奈川県茅ケ崎市萩園2500番地 日本真空 技術株式会社内